三酸化タングステンに関する二三の考察

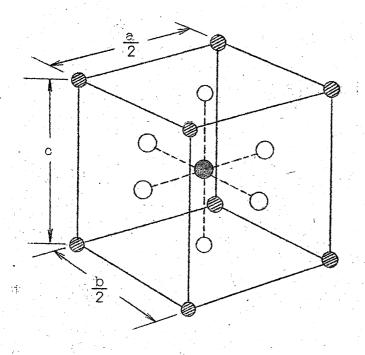
近畿大·理工 児 島 俊 臣 (6月19日受理)

§ 1. はじめに

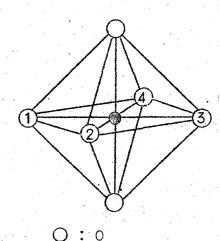
酸化タングステンは、Wの原子価が1~6価で酸化物を作ったもので、 W_2O_3 、 WO_2 、 W_2O_5 、 WO_3 等である。この内4価以上で酸化物になった場合は比較的安定である。これらの内で特に WO_3 (三酸化タングステン) は安定 た物質として物理的に興味がもたれている。この WO_3 は、長沢氏 と B.T. 4) Matthias によって高誘電率の物質として報告されてから強誘電体として注目されるようになった。

 WO_3 の単結晶を得るには、普通昇華法によるが、市販の WO_3 の粉末を蓋付きの石英管又は白金坩堝(最適)に入れて空気中で $1340\sim1370$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ $\mathbb C$ に保ってやればよい。しかし 24 時間程度育成しても 2mm 位にしかならず出来る数も少ない。大きな単結晶が必要なときは高圧昇華法 を用いねばならない。いづれの方法に従っても single domain の大きな単結晶を得るのは困難である。又出来た結晶の殆んどが $\mathbb C$ 面結晶である。結晶を上記の温度域で作ると1340 $\mathbb C$ 附近では淡茶黄色で 1370 $\mathbb C$ 附近では黄緑色になる。淡茶黄色になるのは、 WO_3 以外の低位の酸化物やアルカリ、水分等の影響と云われている。又高目の温度で育成され、且成長のよい結晶には、a軸と $\mathbb C$ b軸に平行に $\mathbb C$ $\mathbb C$

 WO_3 の単結晶は,室温では単斜晶系に属し,単位胞に 4 つの WO_3 分子が含まれている。その結晶構造は,図 1 の如く perovskite 型(ABO_3 型)で A の格子点が欠けていて,W 原子が O 原子の作る八面体の中心附近にいる。 6 の 6 の 8 が 9 が 9



W O3 の結晶構造 図 1



: A (空格子点)

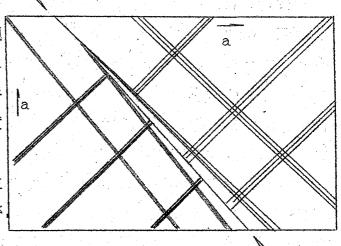
§ 2. W O₃ の熱処理効果と縞模様

WO、の極めて薄い単結晶には、熱処理によって特徴的な緑色の斜格状縞模 様が現われる。この縞模様は、真空に出来るガラス管内にZnの顆粒と極めて 薄い WO_3 の単結晶とを並らべて置き 10^{-2} Torr 程度の低い真空状態で管内 の温度を除々に上げて450~500℃に到ればよい。この模様は、熱処理条

件の違いによって差があるが,大体

(342) (342) 面に行行に出現 図2は、筆者の実験で得られ たものの模写図である。この時の条件 は, 真空が 6×1 0 Torr, 加熱速度 は毎分7~8℃であり450℃で15 分間保った場合である。この模様の生 成する原因は今のところ不明であるが NaやHgでは規則性のある模様は出

他の条件(例えば、色々なガス気圏等)



来ない。しかしこれら以外の金属又は、 図2 WO_3 単結晶にみられる 斜格状縞模様の例

ででも出現するかも知れない。

この縞模様の本質が何であるか知ることも重要であるが、W O₃ の色々を実験を行なり時にこの縞の存在が不都合なことになる場合が起り得る。例えば、高温域で真空中に試料を入れて測定するとき炉内の金属、不純ガス等で縞が出来ると正味の測定が出来ない。又高温域での電気的測定に於いては、電極の選び方に重要な意味がある。事実この縞模様は、光学測定中炉内のニクロム線を真鍮製のネジで接続していたことで偶然発見された。

さて、 WO_3 の単結晶が熱処理を受けた時に経験することは、(a) Zn 蒸気がある、(b) 真空中である、(c) 残留ガスがある、(d) 加熱冷却している、(e) 転移点を通っている、等である。これらの内でどれが支配的なのか、或は二・三の条件が重複しているかは解決に時間を要するだろう。しかし、縞模様には、次のような特徴がある。縞のある結晶を空気中に長時間放置すると模様は巾広になったり消える部分が出来る。空気中で加熱すると消える。又真空中での弱い加熱では消失し冷却すると再び現われる、これを繰り返すと消滅する。今のところ Zn 以外では出現しない。縞は結晶の内部に及んでいる。

2-1 縞模様の観察

結晶を熱処理する環境の選らび方によって縞模様が現われるかどうか、真空中・空気中・水素気圏・Zn 蒸気気圏について観察を行なった。これらに関する実験は、上に述べた熱処理効果が夫々独立に起るか或は結晶についての縞がZnとは別に結晶の酸化の促進又は環元によって酸素の挙動が縞と関係するかどうかの知見が得られよう。実験は、熱処理効果を熱処理時間の関数として選らび、夫々15分・30分・60分・120分・180分・240分の時間行なって各時間毎に顕微鏡観察を行なった。その時の結果は、表1の如くである。用いた単結晶は、厚さが35~45μである。

編は、真空中・空気中・水素気圏では出現しなかった。わずかに水素気圏に 顆粒を入れた場合に図るのような模様らしいものが出現した。単結晶では確認 出来なかった。 Zn 蒸気気圏では、縞が出来るが Zn の作用については色々推 論が立てられる。まず結晶内に Zn が入りこんでいるかどうかを調らべた。

-	ramontario de la companya de la comp		<u> </u>		
	試 料	条件	温度(℃)	時間(分)	縞
	単結晶	真空中 6×10 Torr	500	240	×
	単結晶	空気中 1気圧	500	2 4 0	×
	顆 粒	水 素 流量 5cc/sec.	450	120	Δ
1	単結晶	水 素 流量 5cc/sec.	450	120	×
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	単結晶	Zn気圏6×10 ² Torr	450	1 5	0

表 1

2-2 Zn の検出

 WO_3 の縞模様に関して Zn の存在は不可欠のようである。そこで熱処理によって Zn が結晶内に拡散して A の格子点の作る(342)(342)面(24 を照)に集積すると仮定して実験的に検出を試みた。検出の方法は、X 線によるものと光学的をものとで行なった。

(a) + 試 料 - 至 /

X線による場合は、マイクロラウエ, 回折線強度、螢光分析の三つの方法を用いた。マイクロラウエに用いた試料は、結晶内に縞模様のある

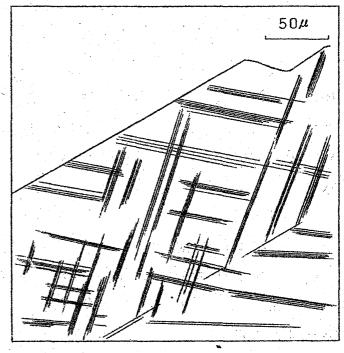


図3 顆粒結晶を環元した時に みられた縞模様の模写図

部分と、ない部分とを作りこの二つの部分のラウエ像を撮影した。

回折線強度と螢光分析には、共通の試料で、真空炉内に WO_3 の顆粒を薄くたらべ、その近くにZnの顆粒をおいて480℃で30分間保持し、その後室温まで冷却した。このような操作を繰り知して試料を集める。そして希塩酸に半日程浸して後よく水洗して充分乾燥させた。光学的た方法の内分光分析は、上記と殆んど同じである。又光吸収による場合は、単結晶を未処理の状態で光透過曲線を求めておき、次に真空中で熱処理して光透過曲線を得ておく。最後

MARCH !

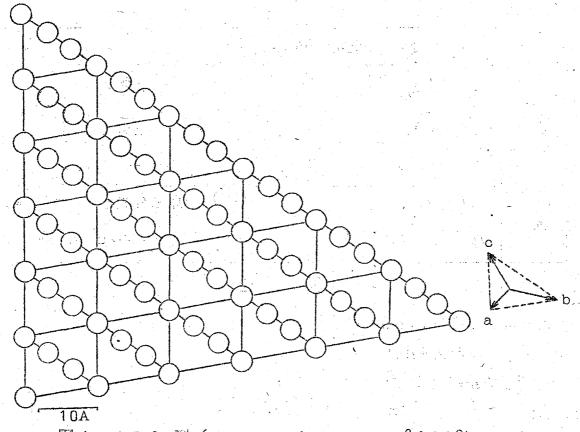


図4 ABO₃型 (monoclinic state, β÷90°)
のA席の(342)面の模式図

に Zn 蒸気気圏で熱処理して縞を持たせて光透過曲線を求める。これから縞の 13) 正味の吸収曲線を得る。これを Mie の理論 (アルカリハライド中のコロイド の光吸収についてはよい結果をもたらしている。)と比較した。これについて は附録を参照して下さい。

(||) 結果

検出を行なった実験の結果は、表2に示している。

マイクロラウエの場合は、 WO_3 の対称性によるラウエ像と Zn による反射点が出るべきだが、縞の部分と結晶部分とで差がなかった、Zn が無秩序に拡散していると弱いハローが出るだろう。これも現われなかった。

回折線の場合は、もし(342)面に Zn が存在し消滅則で消えないたら、(342)面からの反射が出ると期待したが、未処理の試料と熱処理した試料とで回折線全体が殆んど変らなかった。

児島俊臣

		方 法	回折線等の変化	Zn	装置
		マイクロラウエ	×	×	理学電機製 マイクロビーム,写真
,-	X線	回折線強度	×	×	」 理学電機製
		螢 光 分 析	0	×	ガイガーフレックス
	光	分光分析	×	×	島津分光器,QL型,写真
	ال ا	光吸収	0	0	日立ダブルビーム,分光光度計

表 2

螢光分析の場合は,図5 の如く未処理の時と熱処理 した試料とで差が認められ た。しかしこの差は、Zn が結晶内に存在していると 解釈するよりも熱処理によ って低い原子番号の原子が W O₂ に添加されて, これ らの原子による散乱X線が Zn Ka に重なっていると すべきである。 又X線発 生管の陽極 (W) に Zn が 不純物として必ず含まれて いるので、微量を Zn の検1 出には不利は避けられない。 分光分析の結果は, 2m が 微量すぎるのか Zn の線は 現われをかった。光吸収で は、WOz中にコロイド状 Zn が存在すると仮定して

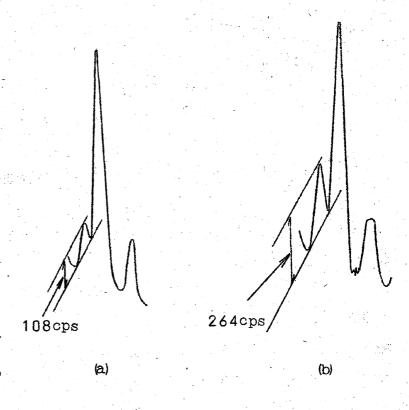


図5 X線螢光分析に於ける $Zn K_{\alpha}$ 線

- (a) W O₃ の未処理顆粒
- (b) Zn 気圏で熱処理した W O₃ 顆粒

理論的に計算した光吸収が実験と定性的に一致した。

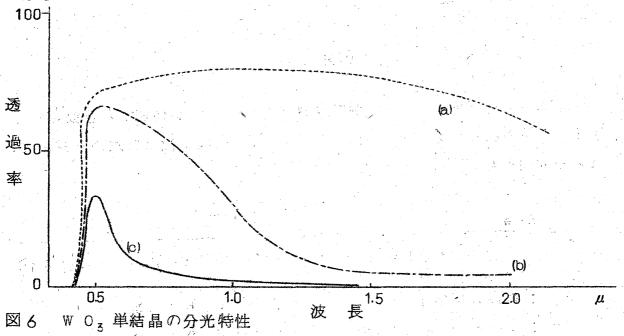
2-3 結 論

 WO_3 と Zn の相互関係は複雑で解決にはまだ日数が必要だろう。

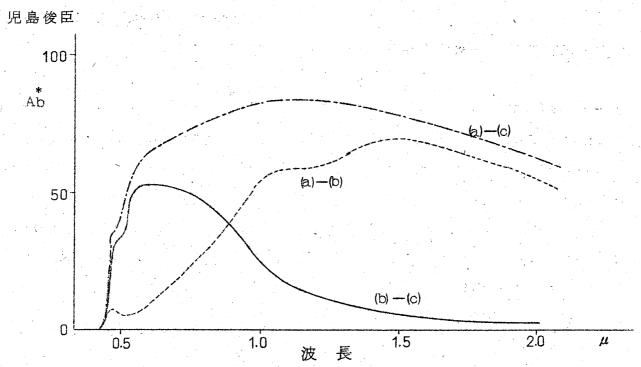
附録

光吸収の実験は、初めに、 WO_3 単結晶(C 面結晶)を未処理の状態で透過率を測定する。次いで真空中で熱処理して透過率を調らべる。

最後に Zn 蒸気気圏で熱処理して縞模様の出現した状態で透過率を測定する。 これらの結果は図7に示している。図7は、図6の(a)(b)(c)の曲線から、真空中の熱処理、Zn 気圏の熱処理、それに縞模様による吸収をまとめて示している。



(a) 未処理結晶 (b) 真空中熱処理 (c) 縞模様をもっている時



WOzの単結晶の吸収曲線

(a)-(c): Zn 気圏の熱処理による吸収

(a) -(b): 真空中の熱処理による

(b)-(c): 縞模様による吸収

*: Ab は、図6から曲線 (a), (b), (c) を夫々 I^a, I^b, I^c として、例えば、(a) - (c) の Ab は、

$$Ab^{(a)-(c)} = \frac{I^a - I^c}{I_0} \times 100\%$$

とした。 I_n:入射光

この縞模様による吸収を WO_3 中にコロイド状のZnが存在すると仮定して G. Mie の理論から計算した。Mie の理論による消滅係数kを求める計算は、 Doyle の利用した方法を用いた。

$$k = \frac{36 \pi NV}{\lambda} \cdot \frac{(n^2 k') n_0}{((n/r_0)^2 + (n k'/n_0)^2)^2 + 4((n/r_0)^2 - (n k'/n_0)^2 + 1)}$$

ことに nn:結晶の屈折率

N:コロイド粒子の数/cc

n:コロイド金属の屈折率 V:コロイド粒子の体積

三酸化タングステンに関する二三の考察

λ:空気中の光の波長

n k': 金属の吸収係数

用いた数値は、 $n_0=2.542$ 、 λ とn、nk'の数値は、Amer. Inst. Phys. H.B Vol. 6 (1957) から引用した。この消滅係数 kと吸収係数 α とは $\alpha=\frac{2\pi}{\lambda}$ k の関係を用い 36π N V は常数とおいた。又実験上の吸収係数は、光学的密度に比例するとした。この計算と実験の結果は、図8の如くであった。

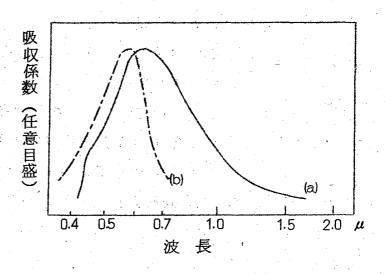


図8 縞模様による吸収係数 (a) 実験値 (b) 計算値

§ 3. 電気的考察

3-1 W O₃ 単結晶の電気的性質

W 0_3 は、 $BaTiO_3$ に次いで見い出された強誘電体と云われている。誘電率の測定は、古く 1931 年 A . Beet によって試みられたが、 高電場での測定は不成功に終った。 W O_3 に関する強誘電性は、長沢氏 がタングステン酸化物の高誘電性を指摘し、その中で W O_3 を特に高誘電性物質として焼成磁器について高周波域で誘電率 (ϵ) が 2000 以上の値をとることを示した。この報告以後 W O_3 は、強誘体として注目された。今日、 W O_3 の ϵ は、強誘電相で 300 位とされている。 この結晶には、いくつかの転移点がある。 900 では、tetragonal ーtetragonal で対称性が変化し 900 で以下では antiferroーelectric で、 700 で附近(685 で: Cocling 720 で: heating)で orthorhombic に移り、 330 でからりでまで、 monoclinic で antiferro が続く。 0 でを過ぎると ferroelectric になる。 0 で以下では、特徴的な履歴があり、温度を下げるとー50 で monoclinic の対称性が高くなり、逆に結晶の温度を上げたときは、 -10 で ferroelectric が消える。この -50 でより高目の温度域では、 ϵ に大きを異方性(ϵ_8 =

 9×10^4 , $\epsilon_b = 4 \times 10^4$, $\epsilon_c = 6 \times 10^3$) がある。 ϵ は,温度を上げて行くと高い導電性のために測定出来なくなる。

 WO_3 の単結晶は,先天的に金属性正イオンが過剰た結晶に属し, WO_3 の高い導電性は,強誘電体としてよりも半導体的性質に興味がもたれるようにたった。 WO_3 の導電性についての測定は,S.Sawada によって紹介され,permittivity の温度依存性において S.Sawada によって紹介され, S.Sawada によって紹介は、S.Sawada によって、S.Sawada によって、S.S

又、S. Sawada and G.C. Danielson は、更に詳しく ρ の温度依存性を調べ室温で $\rho=0.17\Omega$ cm を得ている。加えてホール係数(R)も測られて R=+6.2 cm / coul. の値を示している。この報告においても W O_3 が非オーム性であることを指摘し、結晶の個性と考えられている。

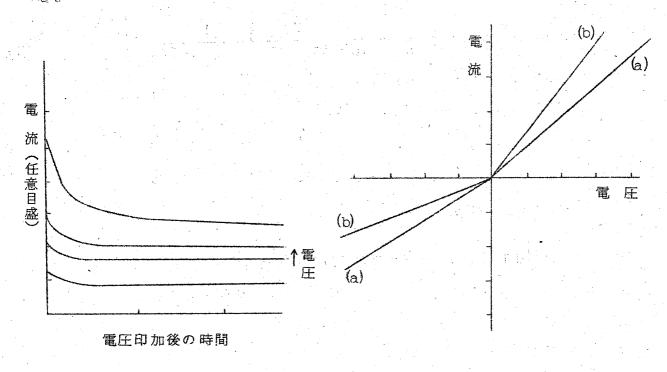
そして結晶による整備特性を示すものもあると云っている。一方谷崎氏 は、 ρ について100℃~-70℃の間で測定を行たった。そして Au の蒸着電極を用いても整備特性の起ることを認めた。室温では、 ρ = 0.4 Ω cm であり、 ρ cm 17℃で0.7~0.4,-40℃では1桁程の飛びの現われることを指摘した。しかしこの飛びの生じる温度は、前述の転移温度と直接にはむすび付かたい。筆者は、V 0 3 単結晶の半導体的性質とV 2 で述べた縞模様に関する熱処理効果とを結び付けて、熱処理効果と電流電圧特性、それにV Stress の影響を実験した。

3-2 電気的実験

電気的な測定を行たうまえにまず炉から取り出されたままの W O₃ の単結晶 (未処理結晶とよぶ)を色々の厚さで用意し、それらの示す電流電圧特性を調べた。用意した装置は、以前報告 した時の電気回路と同様で白金押し付け電極である。電極部は、一枚の白金電極板を固定した絶縁板の上に貼り付ける。これに対向するもう一枚の電極は細く長い絶縁棒に取り付ける。この棒は、上

下には自由に動くが左右には嵌め込み溝で移動したいように取り付けてある。 そして棒の先端には,棒の自重以外の圧力が加えられるように分銅皿がついて いる。

実験は、試料の選択から始めた、単結晶は§2と同じ厚さである。そして用 意した未処理結晶を電極間にはさみ一定の電圧のもとで電流と時間の関係を調 べた。そして図9の如く安定した充電電流と充分時間後の漏れ電流の得られた 結晶を用いた。これらの試料について電流と電圧の関係を測定したら図10-(a), (b) の如きオーム性に近いものと非オーム性を示す二様のものがみられ た。そして熱処理を受けた試料で測定に特徴的な現象を示したものをことに述 べる。



(パラメーターは電圧)

図9 W O 単結晶の漏れ電流 図10 W O 単結晶の電流電圧特性 (a) ohmic (b) non-chmic

(i)真空中の熱処理

真空中の熱処理は、6×10 Torr. で毎分7~8℃の加熱速度で500℃ まで温度を上げた。

その後は、炉を取り除いて冷却した。この熱処理を受けた結晶の内で、未処

理の時に図11-(a) のような電流電圧特性を示していたのが図11-(b) に示す関係に変化したものが見い出された。この関係は、顕著なものでないが 21) 22) 整流特性になっている。整流特性については、沢田、谷崎氏 の未処理結晶についての報告にみられる。

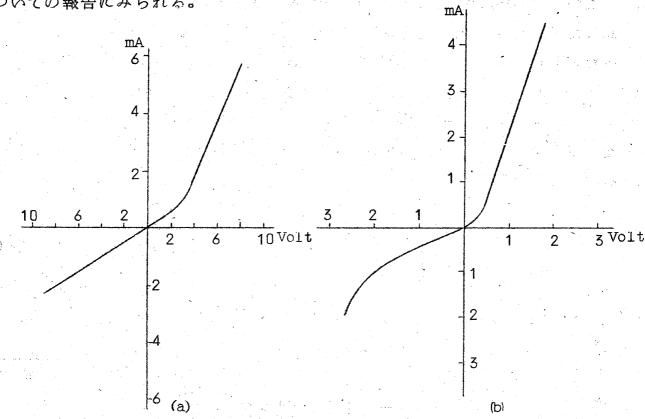


図11 W O₃ 単結晶の電流電圧特性 (a) 未処理の時 (b) 真空中熱処理

() 水素気圏

水素気圏での熱処理は、表1の条件で加熱速度は(|)と同じである。そして最高温度 480 ℃ から水素を焼したがら除冷した。この場合には、未処理のとき図12-(a)の関係を示していたものが環元によって図12-(b)の如く電流値が2桁程大きくたり、同時に小さい turn-over 現象も現われた。又電流電圧の関係に履歴現象が生じた。

(iii) 亜鉛蒸気気圏

Zn 気圏の熱処理は、表1の条件で行なわれた。そして試料には縞模様の含

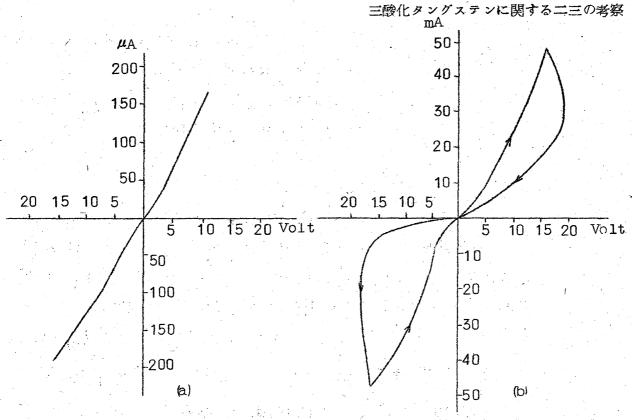


図12 環元された W O₃ 単結晶の電流電圧特性 (a) 未処理 (b) 環元後

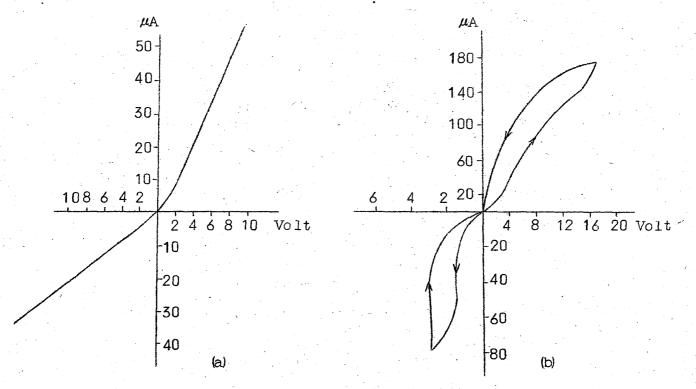


図13 Zn 気圏で熱処理されたWO₃ 単結晶の電**備電圧特性** (a) 未処理 (b) 熱処理後

まれた状態で測定した。なお結晶表面に起る熱処理効果も亦含ませるため試料 は炉から取り出したきま用いた。この場合の未処理結晶との比較は、図13-(a),(b) に示している。Zn 気圏で熱処理した時の変化の特徴は、電流値に 大した変化は生じないが、電流電圧の関係に履歴現象が伴なり。

(IV) 圧力効果

真空中で熱処理(30分)を受けた結晶の内で厚さ37 μ で面積0.18 $_{mm}^{2}$ の結晶について圧力と電流電圧の関係を実験した。試料を電極間にはさみ除々に圧力 (P) を加えて行くと電極間電圧 (V) をパラメーターにして電流 (I) と圧力 (P) の関係は,図14の如き結果を得た。これらの曲線は,Vに無関係にある Pのところで peak をもつ,この peak に到るまでは $\frac{1}{(\partial P)}$ は,図15ー(a) の如く一定の割合で増加し,peak を過ぎると $\frac{1}{(\partial P)}$ は,図15ー(b) のように一定の値となる。この圧力効果は,厚みのある結晶では殆んど観測されず,極めて薄い結晶では割れ目が生じて測定がうまく行なえたい。

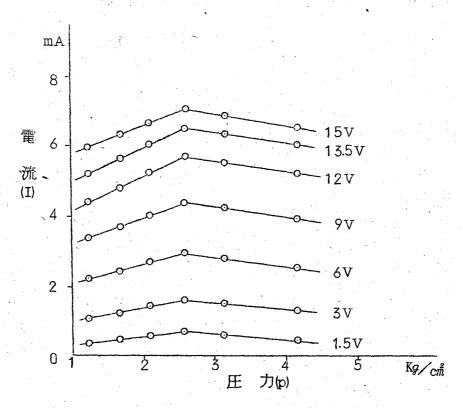
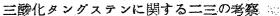


図14 真空中で熱処理された W O₃ 単結晶の圧力効果 (パラメーター印加電圧)



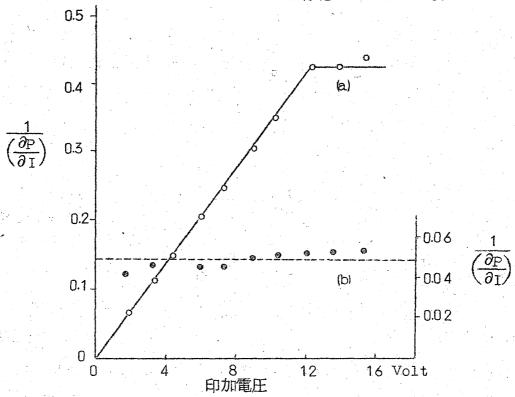


図15 圧力勾配と印加電圧の関係 (a) 電流の増加域 (b) 電流の減少域

3-3 結果の考察

W O_3 の熱処理効果を考察する前に同じ A B O_3 型の BaTiO $_3$ の電気伝導の報告 を参考にしておこう。 BaTiO $_3$ は,環元を受けると $2.5\,\mu$ 附近に中広い吸収を生じる。これは,結晶に酸素欠陥(O 欠陥とよぶ)を生じこの欠陥が電荷の中性を保つために電子が捕らえられ,この電子の励起によって起こる。この電子のエネルギー準位は,伝導帯の下約 $0.5\,\mathrm{eV}$ のところにある。又一方 BaTiO $_3$ は,環元によって電気伝導の活性化エネルギーは, $0.6\,\mathrm{eV}$ になり,O 欠陥の捕獲電子は熱的に解放されて伝導帯に上がって電気伝導に寄与する。結晶中にO 欠陥が多数生じると捕らえられた電子の波動関数が互に重なり合って来て,電子は,伝導帯に上らず隣の欠陥に飛び移るため電子伝導が起ることも考えられる。以上の事柄との対比で W O_3 の場合を考えてみよう。

(1) WO_3 の ohmic と non-ohmic conduction WO_3 は、一般に結晶化した時は、W イオンが過剰を状態になっている。こ

のため先天的に 0 欠陥を含んでいて、この欠陥に捕らえられた電子の内熱的に解放された電子が多いと、結晶の導電性は、自由電子による金属の場合に近いものになる。又一方、捕獲電子が電界の印加によって引き出されるときは、半導体的傾向を示すだろう。

・ 図11-(b) のような整流特性は、未処理結晶の場合とあまり差がない。 従って真空中の熱処理が効果的なものになっていない。整流特性については、21) 22) 沢田 谷崎氏 も認めている、だから WO_3 は、実は、 WO_{3-x} でx が結晶によって異なっている。あるx の値をもつ結晶ならば未処理の場合でも整流特性を示すことは充分考えられる。

(||) 水素気圏での効果

水素気圏では、環元を受けたために電流値が 2 桁程大きくなったことが特徴的である。どの理由は、 $BaTiO_3$ の場合と同様に 0 欠陥に捕らえられた電子の寄与による導電性の増加である。この他に電流電圧特性に履歴現象と、弱い turnover 現象が伴なう。これは、電極との接触部での熱作用と云われている。又接触層には、不純物イオンが集まり電気伝導を複雑なものにする。

(III) Zn 気圏

Zn 気圏の場合も真空中の時と同じように未処理の場合に比して電流値は殆んど変らない。しかし履歴現象が生じた。これは、(II)のときと同様に結晶の表面に関係するだろう。

Zn 気圏の熱処理では, $(W O_{3-x} + Z_n) + 熱 \rightarrow \{(W O_{3-x}, + Z_n O)\}$ 室温 $\}$ の反応が推論され ZnO が(342)面に現われる。 ZnO でのため ZnO での欠陥が増し,導電性が少し高くたり,結晶表面には,ZnO が層状に集っていると考えられる。表面の ZnO が不純物 ZnO が影響をもつと思われる。

(iv) 圧力効果

真空中の熱処理は、先に述べたように結晶に対して顕著な変化を与えない。 従って、圧力効果は、未処理の結晶に於いても生じると予測される。ところで、 W 0_3 単結晶に一定の電圧を印加しておいて加える圧力を変えると電流値が変 る。このようなことは, $BaTiO_3$ に於いては,圧力で固有抵抗が変化し,更 CE にその変化は,圧力に対して履歴を示すと報告されている。 W CE に起るこの 関係は,圧力の増加に従って電流が増加し,ある圧力のもとでは,印加電圧に 関係なく CE か現われる。この CE peak を過ぎると圧力の増加に対し電流は減 少する。実験に使用した結晶は, CE domain を含んでいて,その表面が互にわず かジグザグしている。圧力が増加すると電極と結晶表面との接触面積が増す。 白金電極は, CE の CE に対して CE の CE かので CE かので CE を過ぎると圧力の増加に対しる。 この CE かった圧力でジグザグが整列させられる。この時観測される電流は最大と CE なる。このようた表面の整列は圧力によらず, CE る CE の CE が CE の CE の CE か CE の CE の CE か CE の CE の CE か CE の C

§ 4 光学的考察

4-1 W O₃ 単結晶の光学的性質

W O_3 についての光学的方研究報告は、あまり多くたい。多分、1948年に長沢氏が可視域の屈折率が $2.5\sim2.8$ であると概算したのが初めであろう。その後 S. S awada and G. C. D aniels on C よって屈折率が直接的に測定される、D 、C 各軸方向の屈折率が室温で D を D の D

W 0₃ 単結晶の透過率の温度依存性は、堀江氏らによって詳しく測定された。 そして330℃の monoclinic-orthorhombic の転移点では、結晶中の各 domain の表面が相互にジグザグになっているのが同一面内に整列し透過率が

大きくなることが認められた。又この domain の表面は、相互に数度の大きさがあるが、330℃で0になることが別の光学的方法から実験されている。

700℃の転移点附近では、透過率が減少し、温度に対して履歴がある。

光吸収については、特徴的な吸収はなく、吸収端が室温で4400A附近に27)あり、長波長側は22μでなおかなりの透過率をもっている。

吸収端は、 温度の変化に比較的敏感に変る $0\sim740$ $\mathbb C$ の範囲では、直線的に長波長側にずれる。この現象は、 WO_3 を等方体で近似した場合 Muto-29 Oyama の band 理論 にあてはまる。しかし 740 $\mathbb C$ では、吸収端に大きな飛びが現われる。一方 -10 $\mathbb C\sim50$ $\mathbb C$ では履歴現象を示す。この報告では、 § 2 で述べた熱処理を受けた時に結晶の光学吸収端が、熱処理時間を関数にしてどう変るかを調らべた。

4-2 実験

 WO_3 単結晶の光学吸収端に関する実験は、ナルミ商会製エバート改良型の回折格子分光機を写真法で行なった。連続光の光源には、ハロゲンランプを用い試料に当てた光はC 軸方向に平行で偏光は利用しなかった。露出時間は、パンクロフイルムで夫々の試料について熱処理毎に32分を選らんだ。吸収端波長の決定は、 H_g スペクトルで目盛った分散曲線を利用した。測定に供した結晶は、厚さ $35\sim40\mu$ である、そして各熱処理毎に生じる変化を保存するため炉から取り出されたままにした。

(i) 真空中熱処理

真空中での熱処理は、§ 2で述べた表1の条件で処理時間は、30,60,120,180,240分まで行たった。その結果は、図16-(a) に示している。

(II) 空気中

空気中の場合も真空中のときと同様に熱処理毎に縞模様の有無を顕微鏡観察して、吸収端の実験に供した。その結果は、図16-(b)のようになった。

(Ⅲ) 水素気圏

水素気圏の場合は、参考のために、結晶に充分強い環元を施した時のようすを調べた。

非常に小さた結晶では、500°C、15~20分で濃紺色を呈するものと灰にたるものも含まれた、そしていづれも可視光に対して不透明であった。実験は、表1の条件で15, 30, 60, 120分について行たった。その結果は、図16-(c)に示している。

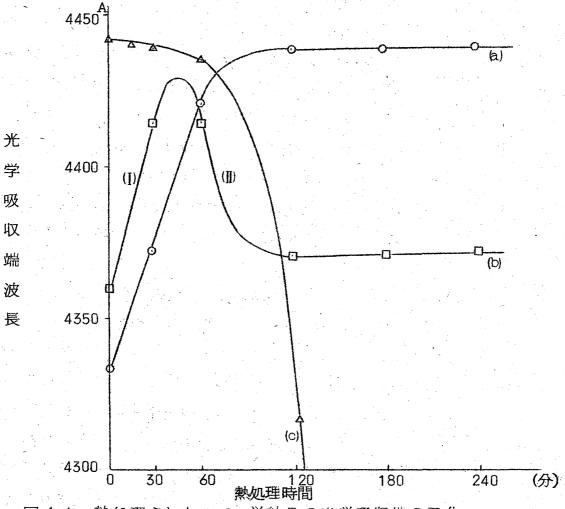


図 1 6 熱処理された W O₃ 単結晶の光学吸収端の変化 (a) 真空中 (b) 空気中 (c) 水素気圏

4-3 結果の検討

 WO_3 を高い真空中で熱処理すると,環元を受けて0 欠陥が増加する。図6 - (b) にみられるように $2.2~\mu$ 附近から巾広い吸収が起る。この吸収は,0 欠陥に捕らえられた電子の励起によって起る。吸収にあずかる電子のエネルギ

一準位は、伝導帯の下約 $0.45\,\mathrm{eV}$ のところにある。 そしてこの吸収は、 $^{24)}$ BaTiO $_3$ の場合 と類似である。強く環元した BaTiO $_3$ では赤外部は可視域に及ぶまで吸収し、可視部の吸収端は長波長側にすれる。

 WO_3 は、先天的にO欠陥を持っているので、低い真空中で熱処理されると 炉内の残留酸素が熱的に結晶内に入り込んでxを減じる。逆にO欠陥も出来易い条件ででもある。電気的考察に従がえば、真空中の熱処理は、顕著な効果は たいが、未処理のときよりもO欠陥を増加させる。又一方不純物を結晶表面に 析出させて結晶を精製し、且焼鈍効果もあるだろう。

真空中で熱処理を受けり欠陥の増した結晶は、0欠陥の電子による吸収の遷移間のエネルギーは同じでも遷移にあづかる電子の数が増え、自然光の内a或はb方向の偏光成分に吸収が生じ結晶の吸収端は、みかけ上長波長側にずれる。吸収端波長が熱処理時間に対して一定にたるのは、ある程度精製されているので、Wと0と0欠陥が平衡状態とたり0欠陥の数が定まるためと思われる。

さて、図16-(b)(I)のところは、真空中の場合と同様な傾向を示し、 未だ0欠陥の存在を示している。(I)のところは、前述したようにab面内 に0欠陥が生じ易いので、逆にここの欠陥が早く酸素でうめられるだろう。従

水素気圏の場合は,環元された $BaTiO_3$ と同様な効果が期待される。W O_3 結晶も環元されると,導電性が高く方っている。勿論,O 欠陥に捕らえられた電子の寄与であるが,吸収端付近では,価電子帯の上に不連続カレベルが出来ていて,このレベルへは,捕獲電子が熱的に遷される。光吸収についてはその端は,長波長側にずれて来るだろう。図16-(c) の結果は,上の期待に対して逆の結果であり,これを WO_3 の異常現象とみれば光学的に興味深い。一方,強く環元した WO_3 は,可視域に不透明に方るので,図16-(c) は,環元の進行によって長波長側に反転するに違い方い。更に詳しい研究は,光電 変換によって進める計画である。

§ 5 総 括

あとがき

この WO_3 の研究については,長年色々と大阪大学の堀江,岩井,川辺各先生の御指導を得ています。ここに御礼申し上げます。X線の仕事に御協力下さいました理学電機の新井,高倉両氏に感謝致します。

匆 文

- 1) 長沢 : 電気化学 16(1948) 13
- 2) 長沢 ; 電気化学 16(1948) 57
- 3) 長沢 ; 電気化学 17(1949) 174
- 4) B.T. Matthias and A. Wood; Phys. Rev. 84 (1951) 1255
- 5) S. Sawada and G. C. Danielson: Phys. Rev. <u>113</u> (1959) 1005
- 6) R. Ueda and T. Kobayashi: Phys. Rev. 91 (1953) 1565
- 7) W.L.Kehl et al. : J.Appl. Phys. 23 (1952) 212
- 8) S. Tanisaki: J. Phys. Scc. Japan <u>15</u> (1960) 573
- 9) T. Horie and T. Iwai: J. Phys. Soc. Japan <u>16</u> (1961) 422
- 10) T. Iwai and T. Horie: ibid 17 (1962) 1142
- 11) 児島俊臣: 近畿大・理工・研究 3(1968) 1
- 12) T. Horie, K. Kawabe and T. Iwai: Ann. Rep. Scient. Works, Fac. Sci. Osaka Univ. 4 (1956) 45
- 13) G.Mie: Ann. Physik 25 (1908) 377
- 14) 新井智也: 理学電機研究課私信
- 15) W.T.Doyle: Phys. Rev. 111 (1958) 1067
- 16) A.B. Scott et al.: J. Phys. Chem. 57 (1953) 757
- 17) S. Sawada and G. C. Danielson: Phys. Rev. <u>113</u> (1959) 1008
- 18) H. Beets: Z. Phys. 71 (1931) 112
- 19) F. Seitz and D. Turnbull: Solid State Physics 4 131
 (Textbook)
- 20) S. Sawada: J. Phys. Soc. Japan 11 (1956) 1237
- 21) S. Sawada and G. C. Danielson: Phys. Rev. <u>113</u> (1959) 803
- 21) S. Tanizaki: J. Phys. Soc. Japan 15 (1960) 566

三酸化タングステスに関する二三の考察

- 23) 児島俊臣:近畿大・理工・研究 4 (1969) 141
- 24) 川辺, 植松, 犬石:電学誌 84(1964) 126
- 25) B.L. Mattes: J. Appl. Phys. 34 (1963) 682
- 26) 木名瀬他:物理学会予稿集 125 (1962. 春)
- 27) T. Kojima: J. Fac. Sci. Tech. Kinki Univ. 3 (1968) 5
- 28) T. Iwai: J. Phys. Soc. Japan <u>15</u> (1960) 1596
- 29) T. Muto and S. Oyama: Prog. Theor. Phys. <u>5</u> (1950) 833
- 30) 児島俊臣:近畿大・理工・研究 4 (1.969) 149